Самосогласованный расчет глубоких уровней вакансий Ge и S в GeS методом функций Грина

© З.А. Джахангирли

Азербайджанский технический университет, Баку, Азербайджан Институт физики АН Азербайджана, Баку, Азербайджан E-mail:cahanzakir@yahoo.com

(Поступила в Редакцию 2 июня 2009 г.)

На основе теории функций Грина в базисе локализованных орбиталей рассмотрена электронная структура локальных дефектов. Обсуждены электронные состояния в запрещенной зоне, резонансы и изменение электронной плотности в кристалле с дефектом.

Точечные дефекты в полупроводниках существенно влияют на их транспортные, электрические и оптические свойства. Методом эффективных масс можно определить энергетические структуры мелких дефектных уровней. Как известно, применение этого метода к дефектам, создающим сильно локализованные возмущения, не увенчалось успехом. Для расчета глубоких уровней кристалла с точечным дефектом часто применяются кластерные методы, метод расширенной элементарной ячейки, метод функций Грина [1–4] и т. д. Метод функций Грина обладает тем преимуществом, что в нем в полной мере используется трансляционная симметрия идеального кристалла и изменения в электронной структуре идеального кристала при создании локального дефекта рассчитываются непосредственно.

В настоящей работе методом функций Грина с использованием линейных комбинаций атомных орбиталей (ЛКАО) самосогласованным образом исследованы глубокие дефектные уровни идеальных вакансий германия ($V_{\rm Ge}$) и серы ($V_{\rm S}$) в полупроводниковом соединении GeS типа $A^4{\rm B}^6$.

Следует отметить, что орторомбические кристаллы GeS представляют собой слоистые соединений с сильно выраженной анизотропией физических свойств. Обнаружение эффектов переключения и электрической памяти, возможность записи голограмм на естественных поверхностях кристалла обусловливают их практическое применение в электронике и оптоэлектронике. Элементарная ячейка кристалла содержит два слоя. Каждый слой состоит из двух попарно соединенных гофрированных плоскостей, содержащих катионы и анионы. Два ближайших соседа катиона (аниона) расположены на этих гофрированных плоскостях, третий — на соседней гофрированной плоскости. Расстояние между слоями гораздо больше, чем ближайшие межатомные расстояния внутри слоев. В соединениях типа GeS каждый атом катиона (аниона) образует три связи с соседними атомами аниона (катиона). Эти связи образуются тремя гибридизированными р-функциями каждого из атомов с некоторым малым вкладом s-состояний. В результате образуются три направленные к ближайшим соседям локализованные орбиты [5].

Функций Грина возмущенного кристалла *G* связана с *G*⁰ для идеального кристалла уравнением Дайсона [1,3]

$$G = (1 - G^0 U)^{-1} G^0, (1)$$

где U — потенциал дефекта. Собственные значения гамильтониана H^0 идеального кристалла соответствуют полюсам G^0 . Гамильтониан H возмущенного кристалла имеет собственные значения там, где H^0 имеет собственные значения, а также на энергиях, соответствующих полюсам $(1 - G^0 U)^{-1}$ в запрещенной зоне. Для состояния в запрещенной зоне получим

$$[1 - G^0(E)U]\Psi = 0, (2)$$

где Ψ — волновая функция возмущенной системы. Локализованные состояния соответствуют нулям детерминанта

$$D(E) = \text{Det} ||1 - G^0 U|| = 0.$$
(3)

Разлагая Ψ по полным ортонормированным базисам φ_{α} , (3) можно выразить в матричной форме

$$\operatorname{Det}[\delta_{\alpha\beta} - (G^0 V)_{\alpha\beta}] = 0.$$

Поскольку потенциал возмущения является короткодействующим, если в качестве базиса использовать локализованные функции, малое число матричных элементов *U* будет отлично от нуля.

Изменение плотности состояний $\Delta N(E)$ в разрешенной зоне

$$\Delta N(E) = \frac{1}{\pi} \frac{d\delta(E)}{dE},\tag{4}$$

где

$$\delta(E) = -\arctan[\operatorname{Im} D(E)/\operatorname{Re} D(E)].$$
(5)

В результате перераспределения валентных электронов изменение плотности заряда $\Delta \rho_V$ вокруг дефекта определяется формулой

$$\Delta \rho_V = \int_{-\infty}^{E_V} [\rho(E) - \rho^0(E)] dE$$

= $\frac{2}{\pi} \operatorname{Im} \int_{-\infty}^{E_V} \{1 - [1 - G^0(E)U]^{-1}\} G^0(E) dE,$ (6)

где

$$\rho^0(E) = -(2/\pi) \operatorname{Im} G^0(E), \quad \rho(E) = -(2/\pi) \operatorname{Im} G(E),$$

 E_V — потолок валентной зоны. Это уравнение выражает изменение электронной плотности $\Delta \rho_V$ через потенциал возмущения *U*. Полное изменение электронной плотности $\Delta \rho$

$$\Delta \rho = \Delta \rho_V + \sum_i |\psi_i\rangle \langle \psi_i|, \qquad (7)$$

где ψ_i — волновая функция занятых локализованных состояний в запрещенной зоне.

Вычисления проводились самосогласованно в приближении локальной плотности. Уравнение Пуассона связывает потенциал возмущения с $\Delta \rho$ и обеспечивает самосогласованность. Обменно-корреляционные потенциалы вычислялись по схеме Сеперли и Алдер, параметризованной Пердю и Цунгером. В качестве затравочного потенциала возмущения U выбран равный по абсолютной величине и противоположный по знаку псевдопотенциал атома вакансии. Нелокальные псевдопотенциалы из первых принципов конструировались по схеме, предложенной в [6]. При вычислении распределения заряда валентных электронов интегрирование по зоне Бриллюэна заменено суммированием по специальным точкам, выбранным по схеме Монхорста-Пака. Поскольку нейтральный дефект не создает дальнодействующего кулоновского потенциала, потенциал дефекта полностью экранируется. Как видно из рис. 1, после самосогласования возмущение эффективно экранируется и локализуется в пространстве в радиусе 3.5 а.u., т.е. меньшем, чем расстояние до ближайших соседей (4.6 а.u.).

Для того чтобы определить функцию Грина идеального кристалла, мы вычислили зонный спектр идеального кристалла в базисе плоских волн. Известно, что метод локальной плотности дает хорошие разультаты для основного состояния системы, но приводит к заниженной величине запрещенной зоны. Так как нашей основной задачей является определение локальных уровней в энергетической щели, для получения удовлетворительного значения ширины запрещенной зоны при расчете зонной структуры экранирование ионного заряда, а также обменно-корреляционные эффекты учитывались в рамках диэлектрического формализма по модели Хаббарда-Шема [7]. Матричная форма функции Грина и потенциала дефекта U определена в базисе ЛКАО. В качестве радиальных функций использовались слетеровские функции [8] s- и p-типа, локализованные в центре и около ближайших четырех соседних атомов. Мы исследовали сходимость энергетических уровней с добавлением *d*-типа локализованных функций. При



Рис. 1. Возмущающий потенциал дефекта. $1 - V_{\rm S}$, $2 - V_{\rm Ge}$.

этом результаты расчета существенно не менялись, а компьютерное время увеличивалось многократно. При вычислении матричных элементов функции Грина и потенциала дефекта U, чтобы избежать суммирования по ячейкам и вычисления многоцентровых интегралов, мы определили указанные выше матричные элементы в пространстве обратной решетки. Для этой цели локализованные орбиты разложили по плоским волнам. Фурье-образ слетеровских орбиталей легко находится в аналитическом виде. Если известны коэффициенты разложения, все матричные элементы могут быть определены в представлении плоских волн.

Вакансия возникает при удалении атома катиона или аниона. Каждая катионная (анионная) вакансия окружена тремя ближайшими анионами (катионами). Точечная группа как Ge-, так и S-вакансии (C_{th}) состоит из следующих элементов: {E} — единичный элемент; { σ_V } плоскость отражения, перпендикулярная оси x и проходящая через вакансию (оси выбраны как в [9]). Всего имеем два одномерных представления, и поэтому все дефектные состояния являются невырожденными. Согласно точечной симметрии, эти дефектные состояния или симмеричны, или антисимметричны относительно плоскости отражения.

В результате расчета мы получили одно локализованное состояние в фундаментальной запрещенной зоне (при $E_V + 0.27 \,\text{eV}$) и локализованное состояние в щели валентной зоны (при $E_V - 12.3 \text{ eV}$) в случае Ge-вакансии и одно локализованное состояние в фундаментальной запрещенной зоне (при $E_V + 0.35 \, \text{eV}$) в случае S-вакансии. Так как потенциал S-вакансии носит более отталкивающий характер, чем Ge-вакансии, ее локализованный уровень расположен выше по энергии. На рис. 2 показаны распределения электронной плотности для локализованных состояний в запрещенной зоне на плоскости (010), проходящей через атомы Ge и S, удаленные из идеального кристалла при создании соответствующей вакансии. Как видно из рисунка, локализация уровня V_S за счет более сильного потенциала дефекта больше, чем у V_{Ge}. Оба состояния пустые. Распределение электронной плотности для обоих типов вакансий подобны. Это объясняется тем, что V_S и V_{Ge}



Рис. 2. Распределение электронной плотности для локализованных состояний в запрещеной зоне на плоскости (010). *a* — *V*_{Ge}, *b* — *V*_S.

имеют подобные окружения атомов. Все три ближайших соседа обеих вакансий лежат в одном двойном слое, два из них на расстоянии *l* в одном слое, третий — в другом слое на расстоянии h, причем расстояния l и h [5] одинаковы для обоих типов вакансий. Анализ волновых функций, связанных с локализованными состояниями в запрещенной зоне, показывает, что эти состояния в основном сформированы р-орбиталями, локализованными на ближайших соседях, тогда как локализованное состояние около E_V – 12.3 eV в щели валентной зоны в основном образовано *s*-орбиталями, локализованными на ближайших соседях. Это согласуется с тем фактом, что верхняя группа валентной зоны GeS в основном состоит из р-состояний катиона и аниона, а самая нижняя группа состояний — в основном из s-состояний аниона [9,10]. Волновые функции всех локализованных состояний экспоненциально спадают при удалении от дефекта. Симметрия и происхождение этих дефектных состояний могут быть объяснены в терминах линейной комбинации атомных орбиталей. В ЛКАО-модели идеального кристалла [9], используя s- и p-орбитали каждого атома, конструируют орбитали, вытянутые вдоль связи в направлении ближайших соседей данного атома (катиона и аниона). Потом из этих орбиталей создают связывающие и антисвязывающие орбитали, определяющие валентные зоны и зоны проводимости. В случае кристалла с вакансией ближайшие соседи вакансии не могут создавать связывающие и антисвязывающие орбитали, и эти орбитали остаются "болтающимися". В первом приближении можно ожидать, что состояния, связанные с вакансией, представляют линейную комбинацию этих "болтающихся" орбиталей. На самом деле наши расчеты показывают, что локализованные состояния являются в

основном линейной комбинацией этих "болтающихся" гибридов.

Кроме локализованных состояний в запрещенной зоне на фоне разрешенных зон появляются резонансы и антирезонансы. Антирезонанс при $E_V - 6 \,\mathrm{eV}$ для $V_{\rm S}$ появляется в точке, где плотность состояний идеального кристалла имеет минимум, и поэтому соответствует критическим точкам зонного спектра и является квазирезонансом. Особенности при $E_V - 5.5 \,\mathrm{eV}$ для $V_{\rm S}$ и при $E_V - 5.1 \,\mathrm{eV}$ для $V_{\rm Ge}$ определяются собственной природой потенциала возмущения дефекта и являются резонансами.

Автор выражает благодарность Ф.М. Гашимзаде и Г.С. Оруджеву за обсуждение результатов.

Список литературы

- [1] М. Ланно, Ж. Бургуэн. Точечные дефекты в полупроводниках. Теория. Мир, М. (1984). 264 с.
- [2] P. Kruger, J. Pollamann. Phys. Rev. B 38, 10578 (1988).
- [3] J. Bernholc, N.O. Lipari, S.T. Pantelides. Phys. Rev. B 21, 3545 (1980).
- [4] O.V. Farberovich, A. Yaresko, K. Kikoin, V. Fleurov. Phys. Rev. B 78, 085 206 (2008).
- 5] Ф.М. Гашимзаде, В.Е. Харциев. ФТТ 4, 434 (1962).
- [6] G.B. Bachelet, D.R. Hamann, M. Schluter. Phys. Rev. B 26, 4199 (1982).
- [7] В. Хейне, М. Коэн, Д. Уэйр. Теория псевдопотенциала. Мир, М. (1973). 557 с.
- [8] D.J. Chadi. Phys. Rev. B 16, 3572 (1977).
- [9] F.M. Gashimzade, D.G. Guliyev, D.A. Guseinova, V.Y. Shteinshrayber. J. Phys.: Cond. Matter 4, 1081 (1992).
- [10] L. Makinistian, E.A. Albanesi. Phys. Rev. B 74, 045 206 (2006).